

### Сведения об официальном оппоненте

по диссертации Иванова Владимира Викторовича «Исследование эффектов оптической близости и разработка методов их коррекции для критических литографических слоёв технологии производства СБИС проектных норм 65 нм», представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 2.2.2 – Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств.

фамилия, имя, отчество оппонента (полностью)	Овчинников Вячеслав Алексеевич
ученая степень; ученое звание; шифр и наименование научной специальности(-ей), по которой(ым) оппонентом защищена диссертация (если доктор наук - по докторской)	Кандидат технических наук Специальность: 05.27.06 Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники
Полное название организации - основного места работы;	Акционерного общества «Зеленоградский инновационно-технологический центр»
структурное подразделение;	Отдел проектирования и изготовления фотошаблонов
должность в этой организации;	Главный специалист
почтовый адрес места работы;	124527, г. Москва, Зеленоград, Солнечная аллея, дом 8
телефон, e-mail	903-182-11-68, e-mail: ova@fotoshablons.ru
список основных публикаций оппонента по тематике рассматриваемой им диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние пять лет (2014-2018), не более 15-ти публикаций	<p><b>Овчинников В.А</b> Технологические режимы поиска дефектов маскирующего покрытия фотошаблона на установке контроля топологии ЭМ-6029М //Известия вузов. Электроника.-2009. №3(77).-С.85-87.</p> <p><b>Овчинников В.А</b> Коррекция геометрической формы топологического элемента фотошаблона на лазерном генераторе изображения ЭМ-5189 //Естественные и технические науки.-2009.- №4.-С.502-505.</p> <p>С.Аваков, д.т.н., В.Беспалов, д.т.н., В.Овчинников, Л.Пушкин, Е.Титко. Лазерная литография. Коррекция формы субмикронных элементов.//Выпуск №8/2009 Электроника НТБ (наука, технология, бизнес)-научно технический журнал</p> <p>В.А.Беспалов, <b>В.А.Овчинников</b>, Н.И.Сидоренко, Д.В.Базанов, А.Н.Беленков, В.Дорл, И.Штольберг «Опыт изготовления прецизионных фотошаблонов с применением высокоточных генераторов изображения» //Известия вузов.Электроника №2(94) 2012 . С.55-60</p>

.Беспалов В.А., Кононов А.Н., **Овчинников В.А.**, Киреев В.Ю., Трапашко Г.А., Немчин Д.Ю., Черкашин В.А., Миленский Д.М., Базанов Д.В., Веревкин А.Т., Сидоренко В.Н. Введение в дизайн фотошаблонов для изготовления микро-и наносистем. Cadence Mask Compose//Москва.Бином.Лаборатория знаний.2013.С.199

**В.А.Овчинников**, С.Д.Петручук «Исследования и оптимизация технологического процесса изготовления смешанных комплектов фотошаблонов с использованием технологии формирования топологической структуры методом электронно-лучевой и лазерной литографии» //Микроэлектроника и информатика-2014. Тезисы докладов.

С.Аваков, д.т.н., Е.Драгун, С.Карпович, д.т.н., Д.Титко, В.Шоломицкий, **В.Овчинников. к.т.н.** «Оптико-механическое оборудование для бездефектного изготовления фотошаблонов» // №3 (00153) 2016 Электроника НТБ (наука, технология, бизнес)-научно технический журнал.

А.Н. Беленков, **В.А. Овчинников**, С.И. Морозов, Н.С. Хрушев «Опыт коррекции эффектов близости при формировании изображения топологического рисунка ИС на фотошаблоне методом электронной литографии» // Электронная техника. Серия 3. Микроэлектроника.-Выпуск 2(186).-2022г.стр.35-39

А.Н. Беленков, **В.А. Овчинников**, С.И. Морозов, Н.С. Хрушев «Опыт проектирования дизайна и изготовления сложных прецизионных фотошаблонов с элементами компенсации оптической близости OPC (OPTICAL PROXIMITY CORRECTION)» // Электронная техника. Серия 3. Микроэлектроника. - Выпуск 3(187).-2022г.стр.45-51

Кандидат тех. наук,

Главный специалист АО «ЗИТЦ»

/ Овчинников Вячеслав Алексеевич

«30» май 2023 г.

Сведения (подпись) Овчинникова В.А. заверяю.

Начальник отдела кадров  
АО «ЗИТЦ» / Беленков

Печать организации

